



МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ICP ИСТОЧНИКОМ

МВУ ТМ ПЛАЗМА 03

Назначение:

Плазмохимическое селективное (реактивно-ионное, анизотропное) травление диэлектрических и металлических плёнок.

Особенности:

- Рабочая поверхность стола-ВЧ электрода \varnothing 180 мм;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ электрода-подложкодержателя в диапазоне 30-200 Вт;
- Рабочие газы: Ar, SF₆, O₂, CF₄;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ ICP источника плазмы в диапазоне 400-600 Вт;
- Безмасляная система откачки (ТМН300);
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 3 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 2,5 м².

